

www.most.gov.cn

微信公众号 官方微博 公务邮箱 English



中华人民共和国科学技术部
Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China

 搜索

首页 组织机构 信息公开 科技政策 科技计划 政务服务 党建工作 公众参与 专题专栏

当前位置: 科技部门户 > 国内外科技动态

【字体: 大 中 小】

韩国三星首次研发5纳米半导体工艺

日期: 2019年05月22日 09:47 来源: 科技部

韩国《中央日报》发布消息称,三星电子已成功研发出5纳米(nm)半导体工艺,并于4月中正式量产首个利用极紫外光刻(EUV)的7纳米芯片。对于新一代半导体的精密工艺问题,三星电子与各企业间的技术较量也日趋激烈。

三星电子宣布成功开发的5纳米精密工艺采用了比现有的ArF更优越的EUV技术。与ArF工艺相比,EUV短波长,能够更加准确地画出精密半导体的电路。半导体的电路越设计越薄,芯片的尺寸变小,耗电量也同时减小,发热也降低,因此精密工艺尤为重要。

三星电子方面表示,此次开发的“5纳米工艺”通过最优化的单元储存设计,将比已有的7纳米减少25%的面积大小,同时电量使用率提高20%,性能提高10%。

扫一扫在手机打开当前页

打印本页 ▶

关闭窗口 ▶



版权所有：中华人民共和国科学技术部

地址：北京市复兴路乙15号 | 邮编：100862 | 联系我们 | 京ICP备05022684 | 网站标识码bm06000001